

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【公開番号】特開2011-91261(P2011-91261A)
【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-018
【出願番号】特願2009-244535(P2009-244535)
【国際特許分類】

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 31/04 H

【手続補正書】

【提出日】平成24年7月6日(2012.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

基板の表面に形成すべき凹凸構造に対応する潜像パターンを感光体に描画し、前記潜像パターンに応じて選択的に前記感光体に粒子を付着させ、前記感光体に付着した前記粒子を前記基板の表面に転写し、前記転写された粒子をマスクとして、前記基板の表面をエッチングする基板処理方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項10】

感光体に描画された潜像パターンに応じて前記感光体に選択的に付着した粒子が転写される表面と、

前記粒子をマスクとして、前記表面をエッチングすることで前記表面に形成された凹凸構造と

を具備する基板。